

실험실 및 다이아몬드 성장을 위한 원통형 공진기 Mpcvd 기계

품목 번호: KTWB315



소개

보석 및 반도체 산업에서 다이아몬드 보석 및 필름을 성장시키는 데 사용되는 마이크로웨이브 플라즈마 화학 기상 증착 방법인 원통형 공진기 MPCVD 기계에 대해 알아보십시오. 기존 HPHT 방법에 비해 비용 효율적인 이점을 발견하십시오.

자세히 알아보기

<p>마이크로파 시스템</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 마이크로파 주파수 2450±15MHZ, • 출력 전력 1~10 KW 지속적으로 조정 가능 • 마이크로파 출력 전력 안정성: • 마이크로파 누출 ≤2MW/cm2 • 출력 도파관 인터페이스: FD-340, 430 표준 플랜지가 있는 WR340, 430 • 찬물 교류: 6-12L/min • 시스템 정재파 계수: VSWR ≤ 1.5 • 전자레인지 수동 3핀 조절기, 여기공동, 고전력부하 • 입력 전원 공급 장치: 380VAC/50Hz ± 10%, 삼상
<p>반응 챔버</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 진공 누설률 • 한계 압력은 0.7 Pa 미만입니다(Pirani 진공 게이지로 표준 설정). • 챔버의 압력 상승은 12시간의 압력 유지 후 50Pa를 초과하지 않아야 합니다. • 반응 챔버 작동 모드: TM021 또는 TM023 모드 • 챔버 유형: 원통형 공진 챔버, 최대 지지력 10KW, 304 스테인리스 스틸, 수냉식 중간층 및 고순도 석영 플레이트 밀봉 방법. • 흡기 모드: 상단 환형 균일 흡기 • 진공 밀봉: 메인 챔버와 주입 도어의 하단 연결부는 고무 링으로 밀봉되고 진공 펌프와 벨로우즈는 KF로 밀봉되며 석영판은 금속 C-링으로 밀봉되고 나머지는 CF로 밀봉됩니다. • 관찰 및 온도 측정 창: 8 관찰 포트 • 챔버 앞 샘플 로드 포트 • 0.7KPa~30KPa의 압력 범위 내에서 안정적인 토출(전원 압력이 일치해야 함)
<p>샘플 홀더</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 샘플 table≥72mm의 직경, 유효 사용 area≥66 mm • 베이스 플레이트 플랫폼 수냉식 샌드위치 구조 • 샘플 홀더는 챔버에서 전기적으로 고르게 들어 올리고 내릴 수 있습니다.
<p>가스 흐름 시스템</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 모든 금속 용접 에어 디스크 • 장비의 모든 내부 가스 회로에는 용접 또는 VCR 조인트를 사용해야 합니다. • 5채널 MFC 유량계, H2/CH4/O2/N/Ar, H2: 1000sccm; CH4: 100sccm; O2: 2sccm; N2: 2sccm; Ar: 10sccm • 작동 프레스 0.05-0.3MPa, 정확도 ±2% • 각 채널 유량계에 대한 독립적인 공압식 밸브 제어
<p>냉각 시스템</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 3 라인 수냉식, 온도 및 흐름의 실시간 모니터링. • 시스템 냉각수 흐름은 ≤ 50L/min입니다. • 냉각수 압력은

- 온도 센서
- 외부 적외선 온도계의 온도 범위는 300-1400°C입니다.
 - 온도 제어 정확도

제어 시스템	<ul style="list-style-type: none">• Siemens smart 200 PLC 및 터치 스크린 제어가 채택되었습니다.• 시스템에는 성장 온도의 자동 균형, 성장 기압의 정확한 제어, 자동 온도 상승, 자동 온도 강하 및 기타 기능을 실현할 수 있는 다양한 프로그램이 있습니다.• 물의 흐름, 온도, 압력 및 기타 매개변수의 모니터링을 통해 장비의 안정적인 작동과 장비의 종합적인 보호를 달성할 수 있으며 기능적 연동을 통해 작동의 신뢰성과 안전성을 보장할 수 있습니다.
--------	--

- 선택적 기능
- 센터 모니터링 시스템
 - 기관 기초 전력